



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种富Cr离子渗氮层及其制备方法和应用

文献类型: 专利

作者 于志明, 韩恩厚, 徐家寅, 朱义芳 and 尹春生

发表日期 2009-03-18

专利国别 中国

专利类型 发明专利

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本发明涉及离子渗技术,具体为一种富Cr离子渗氮层及其制备方法和应用,解决双密封、双紧固支撑的双保险高强度耐压双卡套式管接头中,由不锈钢制成的后卡套的表面功能性强化问题。本发明利用离子渗技术在不锈钢表面获得一定厚度、硬度和成分的离子渗层。其制备方法:首先除去合金表面上的油污,在有机溶剂中超声清洗;然后将洗净的试样置入离子氮化设备的真空室内,抽真空到所需真空度后通氩气进行离子轰击清洗;最后,在离子渗过程中通过调整离子渗功率、氮气以及氩气流量的变化,获得具有良好抑制渗层脆性开裂性能的富Cr渗氮强化层,其渗层中Cr含量为20-40...

公开日期 2009-03-18

语种 中文

专利申请号 CN101386983

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/66808>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 于志明, 韩恩厚, 徐家寅, 朱义芳 and 尹春生. 一种富Cr离子渗氮层及其制备方法和应用. 2009-03-18. **GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
81	0	0

其他版本

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。